

BECA ARTUS-ICPNA WIELS BASES DE CONVOCATORIA 2026

1. PRESENTACIÓN

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) y ARTUS se unen para poner en marcha la convocatoria al Programa de Residencia Artística WIELS, una plataforma de producción multidisciplinar internacional que alberga artistas contemporáneos emergentes y de media carrera de diversas partes del mundo.

WIELS es un laboratorio internacional para la creación y difusión del arte contemporáneo, que provee un espacio de trabajo único para los artistas, en el que pueden continuar su labor desde la experimentación y la innovación en torno a las prácticas de arte contemporáneo. Asimismo, es una institución que integra, en un mismo lugar, las funciones de presentación, producción y educación, en la que los artistas residentes cuentan con el servicio de acompañamiento a proyectos mediante tutorías individuales y colectivas.

Las Becas ARTUS tienen como finalidad apoyar el crecimiento artístico, la reflexión creativa y el desarrollo profesional de artistas jóvenes peruanos a través de becas para residencias artísticas internacionales.

Se invita a artistas visuales de nacionalidad peruana, mayores de edad, cuyo dominio del inglés les permita expresarse con fluidez, a participar en el concurso por la Beca ARTUS-ICPNA, que se llevará a cabo en la Residencia WIELS, en Bruselas, Bélgica, del 1 octubre al 31 diciembre del 2026.

Los postulantes no pueden haber participado con anterioridad en el programa de Residencias Artísticas WIELS.

2. OBJETIVO

El objetivo fundamental de la presente convocatoria es proporcionar la movilidad internacional a un artista visual peruano, otorgándole durante tres meses un programa de mentoría, que incluye un espacio de trabajo individual e interacciones profesionales dentro de la vida artística y cultural de Bruselas. Mediante esta Residencia se busca también establecer conexiones entre la escena artística de Bélgica y del Perú.

3. POSTULACIÓN

Las solicitudes se cursarán en inglés a más tardar el día 1 de junio del 2026, vía correo electrónico a residency@icpna.edu.pe.

Se debe incluir los siguientes documentos:

- A. Currículum vitae actualizado.
- B. Declaración del artista: En 250 palabras o menos escribir un texto sobre tu trabajo.
- C. Declaración de propósito: En 300 palabras o menos describir sus proyectos potenciales, ideas y expectativas para la residencia WIELS, incluyendo algunas ideas sobre el proyecto que quisieran desarrollar durante su permanencia en la Residencia.
- D. Referencias: Indicar nombre, correo electrónico y teléfono de tres (3) referencias que pudieran comentar sobre su trabajo y su desarrollo artístico a nivel profesional.
- E. Portafolio de proyectos: Seleccionar hasta diez imágenes o videos que serán enviados por correo electrónico con la aplicación en JPG o PDF, tamaño máximo A4 y con resolución 72 dpi (cada imagen será denominada con el apellido del artista, guion bajo, nombre del artista y el número de la imagen (ej. Cortes_Carlos01). Cada video será considerado una imagen. Los videos con documentación sobre el proceso de creación no serán vistos.
- F. Descripción de las imágenes incluida en el portafolio con la indicación de título, fecha, medios, dimensión y una pequeña descripción de cada obra (no más de 50 palabras por cada imagen/video).
- G. Copia del documento de identidad y pasaporte vigente.
- H. Certificación en estudios de arte (artes plásticas).
- I. Carta de autorización por derechos de imagen.

Los artistas son íntegramente responsables de la información y la data que presentan en su aplicación y de las obligaciones que asumen en consecuencia. Se entiende que el artista postulante es el único autor de la propuesta presentada.

En caso de no cumplir con cualquiera de los requisitos o de las disposiciones de fondo y/o forma establecidas para la aplicación, o en caso de no tener disponibilidad para participar en el Programa de Residencia WIELS durante el íntegro de su duración, el artista será descalificado del proceso.

4. SELECCIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

La etapa de selección final de los candidatos para la beca estará a cargo de un comité especializado de selección. Cada miembro de este comité será designado por las partes involucradas en la organización de la beca, lo cual asegura una representación equilibrada y una amplia gama de perspectivas.

Una vez que el comité revise todas las solicitudes, seleccionará los 10 (diez) portafolios más destacados. Estos portafolios finalistas serán posteriormente enviados a WIELS. Será responsabilidad de WIELS seleccionar al único ganador de la beca, basándose en sus propios criterios de evaluación.

Este proceso de selección está meticulosamente diseñado para garantizar la máxima objetividad y para identificar al candidato que mejor represente los valores y el espíritu de la beca.

- A. La decisión final será tomada el 30 de junio del 2026, en la que se decretará a un único ganador. El artista seleccionado será notificado vía correo electrónico o vía el teléfono indicado en su aplicación y será anunciado al público en general a través de los canales de comunicación de WIELS, de ARTUS y del ICPNA.
- B. Si el ganador de la Beca no comunica su aceptación de esta dentro de las 48 horas de haber sido enviado el correo electrónico de comunicación o no pudiera realizar el viaje para hacer uso del beneficio de la residencia, quedará automáticamente descalificado y la Beca será otorgada al primer finalista.
- C. Una vez otorgada la asignación de la Beca, el beneficiario deberá entregar en la sede del ICPNA ubicada en Av. Angamos Oeste 120 - Miraflores, firmado y en físico, el formulario de aceptación del otorgamiento de la residencia que le será enviado.

5. DOTACIÓN PARA LA RESIDENCIA

La Beca incluye:

- Pasaje desde su lugar de residencia hasta Bruselas ida y vuelta.
- Estudio de trabajo de 40 m² y de uso individual dentro de la sede de WIELS y en el periodo previsto para su residencia.

- Alojamiento en apartamento equipado cercano a WIELS, incluyendo los gastos de electricidad, agua, calefacción e internet durante el periodo previsto para su residencia.
- 800 euros por cada mes de estancia, por concepto de manutención y ayuda a la producción.
- Acceso a las instalaciones de WIELS, así como participación en las actividades desarrolladas dentro de su programa para residentes.
- Tutorías semanales por parte de artistas y creadores/as integrados en la plantilla de tutores/as del Programa de Residencia de WIELS.
- Un viaje de campo dentro o fuera de Bélgica. Los gastos de viaje y alojamiento estarán cubiertos, a excepción de las comidas, las cuales correrán por cuenta del beneficiario.
- Una presentación / conferencia pública durante la residencia
- Visitas de estudio por curadores, artistas críticos invitados por WIELS.
- Opción de una pequeña exhibición individual o colectiva en el Cuarto de Proyectos WIELS en los meses o años posteriores a la Residencia, sujeto a disponibilidad del espacio y en coordinación con el Coordinador del Programa. Esto no generara costos adicionales para ARTUS o ICPNA y los fondos necesarios deberán ser conseguidos por el artista.

6. DURACIÓN

El Programa de Residencia WIELS tiene una duración aproximada de tres meses que van desde octubre a diciembre del 2026.

7. PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

- El plazo de inscripción será del 29 de abril al 1 de junio del 2026.
- El formulario de registro se cerrará a las 23:59:59 h del 1 de junio y no se aceptarán solicitudes más allá de este horario.
- Los artistas finalistas serán anunciado el 17 de junio del 2026.
- El artista ganador será anunciado el 30 de junio del 2026.

8. PASAPORTE Y VISA

Es responsabilidad del beneficiario de la beca tener el pasaporte vigente para que realice el trámite de visa y demás documentos legales que sean necesarios que le permitirán realizar el viaje. WIELS podrá entregar una constancia de participación en la Residencia, si fuera necesario. Si la visa no fuera obtenida, o el ganador no pudiese realizar el viaje

para hacer uso de la Beca, queda sin efecto el otorgamiento de la Beca y se elige como nuevo beneficiario al primer finalista.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que presenten, y garantizan que ostentan legítimamente todos los derechos de propiedad intelectual sobre estos. En este sentido garantizan el uso pacífico de dichos proyectos por parte de ICPNA y ARTUS, quienes se eximen expresamente de cualquier responsabilidad por los daños o perjuicios que directa o indirectamente pudiera ocasionar el incumplimiento de esta garantía por parte del participante.

Los autores autorizan a ICPNA y ARTUS el uso de los distintos elementos del proyecto, ya sean textos, imágenes, gráficos o videos para fines promocionales o publicaciones de las actividades.

10. DERECHOS DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes reconocen que ellos y el material que presenten podrán aparecer en imágenes (fotografía, video, etc.) tomadas en relación con su residencia para su posterior difusión informativa o promocional por parte de ICPNA y ARTUS.

Asimismo, acepta que su imagen y la de sus creaciones puedan ser utilizadas en catálogos u otros documentos recopilatorios de la actividad realizados por ICPNA y ARTUS.

11. DATOS PERSONALES

Cada participante, deberá llenar y entregar una carta de autorización de uso de datos personales (que se puede descargar en https://cultural.icpna.edu.pe/portfolio_page/beca-icpna-artus-wiels-2026), para la aceptación del tratamiento de sus datos personales, conforme lo señalado en la Ley de Protección de Datos personales – Ley 29733 y su Reglamento.

12. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Los participantes, por el hecho de presentarse a la convocatoria, aceptan los términos y condiciones de las presentes bases.